

研究成果（小テーマにつき2ページ以内でまとめてください）

サブテーマ名：（1-2 SiGe-TFT技術の開発） 小テーマ名：（1-2-2 SiGe-TFT技術の開発）															
サブテマリーダー（所属、役職、氏名） 高知工科大学 総合研究所 教授 平尾 孝 研究従事者（所属、役職、氏名） 大阪大学大学院 工学研究科 教授 尾浦 憲治郎 大阪大学大学院 工学研究科 助教授 片山 光浩 大阪大学大学院 工学研究科 助手 本多 信一 ()平成17年3月末時点の所属・役職等															
研究の概要、新規性及び目標 研究の概要 SiGe-TFT基本製膜プロセス開発と、単層Si、Ge膜形成技術を開発する。また、積層構造による歪Siの形成技術と歪評価技術の開発を行なう。 研究の独自性・新規性 研究の目標（フェーズ毎に数値目標等をあげ、具体的に）															
研究の進め方及び進捗状況（目標と対比して） フェーズ：共同研究実施期間は平成15年1月～平成17年3月。 フェーズ：															
主な成果 特許件数：0件 査読論文数：0件 口頭発表件数：0件															
研究成果に関する評価 1．国内外における水準との対比 2．実用化に向けた波及効果															
残された課題と対応方針について															
	J S T 負担分（千円）							地域負担分（千円）							合計
	H 14	H 15	H 16	H 17	H 18	H 19	小計	H 14	H 15	H 16	H 17	H 18	H 19	小計	
人件費	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0
設備費	0	2,499	0	-	-	-	2,499	0	0	0	-	-	-	0	2,499
その他研究費 （消耗品費、 材料費等）	200	3,085	1,000	-	-	-	4,285	0	0	0	-	-	-	0	4,285
旅費	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0
その他	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0
小 計	200	5,584	1,000	-	-	-	6,784	0	0	0	-	-	-	0	6,784
代表的な設備名と仕様 [既存（事業開始前）の設備含む] J S T 負担による設備：混合ガス配管装置 地域負担による設備：															

複数の研究課題に共通した経費については按分する。